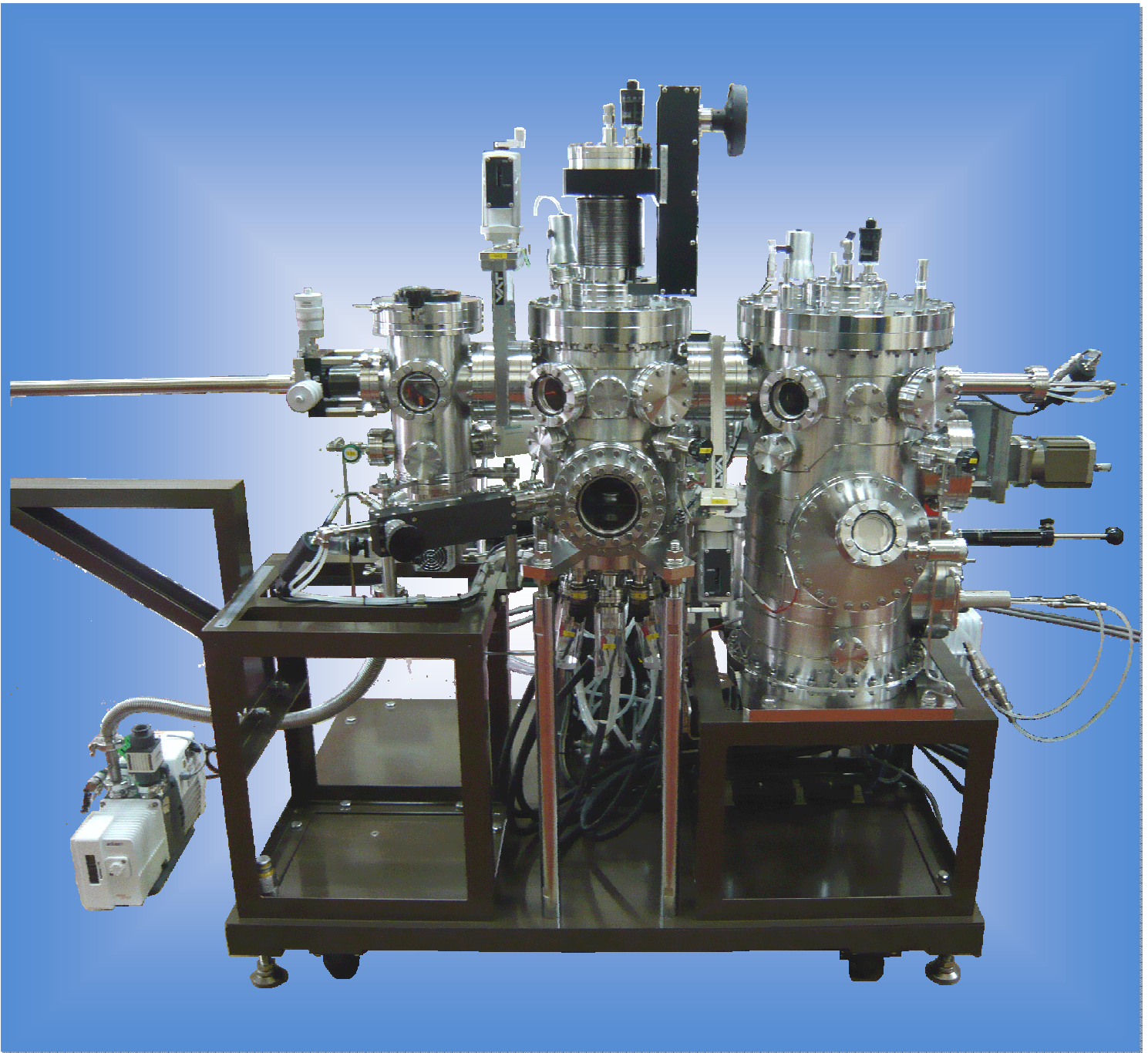


●多機能蒸着装置(マルチ蒸着システム) MVD

本蒸着装置は EB 蒸着室、K-CELL 蒸着室、ロードロック室、グローブボックス(オプション)等により構成され、各室間基板が自由に受渡しでき、大気に曝されずに有機膜、金属膜、デバイスの作製が可能になります。また、各室に多数のオプションの取り付け、研究内容によって構成変更等の対応も致します。



※上記写真は標準品の図になります、実物は仕様に合わせての作製になります。

構成内容・仕様内容

◆EB 蒸着用

E B 蒸着室チャンバー	材質：SUS304 / 表面処理：電解研磨(内面鏡面研磨後) 到達真空度： 5×10^{-6} Pa 以下 / ベーキングヒーター、 必要なポート、予備ポートはご相談ください
E B 電子銃	2kw 3連電子銃、制御電源
基板加熱機構	基板サイズ：ご相談ください。 基板加熱：600℃以上
膜厚計	膜厚モニタ付、膜厚制御可能型 or 表示のみ
真空計	クリスタルイオンゲージ
排气系	TMP 800L/s + R.P 500L/m + 排气配管

◆有機蒸着室

有機蒸着室チャンバー	材質：SUS304 / 表面処理：電解研磨(内面鏡面研磨後) 到達真空度： 5×10^{-5} Pa 以下 / ベーキングヒーター、 必要なポート、予備ポートはご相談ください
通電加熱型蒸着源	ルツボ蒸着 加熱温度：650℃以上 シャッター付
基板冷却機構	上下駆動(Z軸)：S=50 mm 水冷式、シャッター付
膜厚計	膜厚モニタ付、膜厚制御可能型 or 表示のみ
真空計	クリスタルイオンゲージ
排气系	TMP 500L/s + R.P 300L/m + 排气配管

◆ロードロックチャンバ

試料交換室チャンバー	材質：SUS304 / 表面処理：電解研磨(内面鏡面研磨後) 到達真空度： 1×10^{-4} Pa 以下 / 上蓋開閉式、 必要なポート、予備ポートはご相談ください
排气系	TMP 70L/s + R.P + 排气配管
真空計	クリスタルイオンゲージ
基板搬送機構	XYZ ステージ付きトランスファーロード、治具付

◆その他

ゲートバルブ：EB 蒸着室～有機蒸着室～試料交換室間
 N2 パージライン：リークバルブ、レギュレーター、配管など
 架台：材質:SUS304/指定色焼付塗装/機内に水配管、電気配線
 制御システム(ラック)
 安全対策のインターロック付、非常停止スイッチ付、各種コントローラー、計器類など取付
 オプション
 スパッタ源、基板加熱・冷却駆動機構、グローブボックス、グローブボックス受渡し機構、
 基板温度測定用温度計、イオンポンプ

※上記構成・仕様は標準品の図になります、実物は研究内容や、御要りようの装置仕様に合わせたの作製になります。お気軽にご相談ください。